

第43回 先端プラズマ技術研究会（金三会）



NAGOYA UNIVERSITY

名古屋大学低温プラズマ科学研究センター（cLPS）が低温プラズマに関する産業界ニーズにお応えすべく最新の研究内容をご紹介します。講演後に産業界のお困り案件解決にむけて産学官が連携してディスカッションいたします。

ZOOMによるWEBセミナー

参加費：無料

日時： 3月29日（月）

講演 13:00～14:00

質疑応答 14:00～

講師：布村 正太 上級主任研究員

産業技術総合研究所 電子光基礎技術研究部門



タイトル：プラズマ誘起欠陥の検出と制御

講演内容：半導体デバイスの作製にはプラズマプロセスが広く用いられる。プラズマプロセスは、微細加工、ドーピング、極薄膜の形成を可能にする一方、表面に欠陥を形成しデバイス性能を律速する課題を抱える。そのため、このプロセス起因のプラズマ誘起欠陥（plasma-induced defects）を理解し制御することが必要である。本研究会では、水素化アモルファスシリコン（a-Si:H）を用いる結晶シリコン（c-Si）表面パッシベーションを取り上げ、プラズマ誘起欠陥の発生と修復についての最新の研究成果を紹介する。併せて、デバイスの高性能化とプロセス制御について議論を深めたい。

参加申込（事前申し込み制）

名古屋大学低温プラズマ科学研究センター（cLPS）事務局 Webサイトに以下の情報を御記入お願いいたします。お早めの登録にご協力お願いいたします。

<http://www.aip.nagoya-u.ac.jp/industry/about/event/detail/3-1.html>

当日のURLのご案内などは開催日までに別途お知らせします

ご質問お問い合わせ先：

e-mail；contact@plasma.engg.nagoya-u.ac.jp,

TEL；052-789-3460

主催 名古屋大学低温プラズマナノ科学研究センター（cLPS）

HP：<https://www.plasma.nagoya-u.ac.jp>

共催 名古屋大学協力会